

AIW 2: AIW Industrietag II

Time: Thursday 15:30–16:30

Location: DÜL

Invited Talk AIW 2.1 Thu 15:30 DÜL
Infineon sensor solutions with Artificial Intelligence — ●UWE GÄBLER — Infineon Dresden, Germany

Künstliche Intelligenz (KI) verändert komplette Branchen und bietet völlig neue Erfahrungen für die Verbraucher. KI, und insbesondere Machine Learning, verändert die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln und einsetzen. Systemarchitekten müssen neue Denkmuster erlernen, um den Nutzen zu erschließen. Im Entwicklungszentrum Dresden haben wir mit Aktivitäten begonnen, um KI-fähige ASICs für Edge-Anwendungen zu entwickeln. Erfolgsfaktoren sind enge Partnerschaften mit lokalen Universitäten und Instituten, um Herausforderungen wie Ultra-Low-Power, effiziente Chip-Architekturen für die Implementierung neuronaler Netze und die Erklärbarkeit der Ergebnisse zu bewältigen. Im Vortrag werden aktuelle Herausforderungen und An-

wendungsbeispiele Künstlicher Intelligenz in Infineon Lösungen sowie die Aktivitäten des Entwicklungszentrums Dresden vorgestellt.

Invited Talk AIW 2.2 Thu 16:00 DÜL
Photomasks to enable More than Moore — ●GUIDO ÜBERREITER — AMTC Dresden, Germany

Photomasken sind eine wichtige Grundlage der Mikroelektronik und bestimmen über die Auflösung und die Qualität der Fertigung mit. Der deutlich steigende Bedarf an Masken und die Konzentration auf nur wenige Hersteller werden erläutert. Es werden die enormen Anforderungen an die Genauigkeiten der optischen Masken besprochen. Für Technologien kleiner als 12 nm wird auch Extreme UV eingesetzt, was neuartige Masken erfordert.